

Os efeitos de baixa dimensionalidade podem levar um determinado sistema a apresentar propriedades bastante diferentes daquelas que se observa em sistemas massivos. Neste trabalho apresentamos alguns resultados de medidas de caracterização magnética em sistemas de filmes finos de ferro depositados sobre silício vicinal via “sputtering” para duas espessuras: 6 nm e 12 nm. As medidas de caracterização foram feitas usando um magnetômetro ótico de efeito Kerr, o qual permite fazer a rotação da amostra em torno de um eixo normal ao plano da amostra e desta forma observar os efeitos das anisotropias no plano da mesma. Este tipo de medida fornece importantes informações sobre a estrutura magnetocristalina. No caso dos filmes estudados, percebeu-se que as espessuras dos filmes de ferro jogam um papel fundamental.